

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成23年5月12日(2011.5.12)

【公開番号】特開2011-1622(P2011-1622A)

【公開日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【年通号数】公開・登録公報2011-001

【出願番号】特願2009-147250(P2009-147250)

【国際特許分類】

C 22 C 9/00 (2006.01)

C 22 C 9/05 (2006.01)

C 22 C 9/06 (2006.01)

【F I】

C 22 C 9/00

C 22 C 9/05

C 22 C 9/06

【手続補正書】

【提出日】平成23年3月25日(2011.3.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

銅(Cu)及び不可避的不純物と、

前記銅に固溶する第1の添加元素である銀(Ag)と、

前記銅に含まれ、前記不可避的不純物との間で化合物を形成し、前記第1の添加元素とは異なる第2の添加元素とを含み、かつ、

前記第1の添加元素である銀(Ag)は0.005重量%以上0.05重量%以下含むことを特徴とする圧延銅箔。

【請求項2】

0.002重量%以下の酸素を更に含む請求項1に記載の圧延銅箔。

【請求項3】

前記第2の添加元素は、0.001重量%以上0.09重量%以下のホウ素(B)である請求項1又は2に記載の圧延銅箔。

【請求項4】

前記第2の添加元素は、ニオブ(Nb)、チタン(Ti)、ニッケル(Ni)、ジルコニウム(Zr)、バナジウム(V)、マンガン(Mn)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、及びカルシウム(Ca)から1つ選択される元素であり、0.001重量%以上0.09重量%以下含まれる請求項2に記載の圧延銅箔。

【請求項5】

前記第2の添加元素は、ホウ素(B)、ニオブ(Nb)、チタン(Ti)、ニッケル(Ni)、ジルコニウム(Zr)、バナジウム(V)、マンガン(Mn)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、及びカルシウム(Ca)から選択される複数の元素であり、総量で0.001重量%以上0.09重量%以下含まれる請求項2に記載の圧延銅箔。

【請求項6】

圧延面を基準にしたX線回折を用いた極点図測定により得られる結果において、前記極点図測定の = 90°における走査による銅結晶の{022}Cu面回折ピークの平均強

度 [a] と $\theta = 30^\circ$ における 走査による前記 $\{022\}_{Cu}$ 面回折ピークの平均強度 [b] との比 [a] / [b] が、 [a] / [b] ≤ 3 である結晶粒配向状態を有する請求項 2 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の圧延銅箔。

【請求項 7】

20 μm 以下の厚さを有する請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の圧延銅箔。